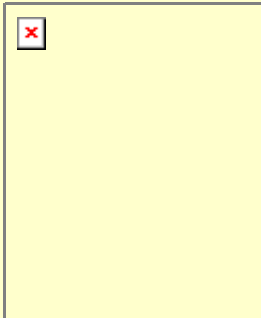


## 本期封面



1999年4期

栏目:

DOI:

论文题目: 射频磁控溅射沉积氮化碳薄膜的结构和成键性质

作者姓名: 郭建东 李银安 赵汝文 王恩哥

工作单位: 中国科学院物理研究所表面物理国家重点实验室, 北京 100080

通信作者: 王恩哥

通信作者Email: [egwang@aphy.iphy.ac.cn](mailto:egwang@aphy.iphy.ac.cn)

文章摘要: 利用反应性质射频磁控溅射在Si(100)单晶衬底上沉积氮化碳薄膜, 并系统地研究了薄膜的结构, 成分及化学键等信息. X射线衍射分析表明, 制备的氮化碳薄膜具有非晶结构. 红外吸收谱说明薄膜中碳, 氮原子结构成化学键.

关键词: 氮化碳薄膜 射频磁控溅射 沉积 结构

分类号: 0484.1

关闭